PREPARATION OF ALUMINA WITH LOW CONTENT OF RADIOACTIVE ELEMENT

Patent number:

JP56164013

Publication date:

1981-12-16

Inventor:

SHIODA SHIGEAKI; MATSUKI TSUTOMU; KAZAMA

SOUICHI; SAKAMOTO AKIRA; HIRAYANAGI

KOUTAROU

Applicant:

SHOWA KEIKINZOKU KK

Classification:

- international:

C01F7/02

- european:

Application number: JP19800067910 19800523 Priority number(s): JP19800067910 19800523

Abstract of JP56164013

PURPOSE:To obtain alumina suitable for using in a semiconductor memory apparatus, by pulverizing a calcined alumina consisting of substantially an alpha-crystal, and washing the pulverized crystal with a dilute mineral acid solution. CONSTITUTION:Calcined alpha-alumina must be finely pulverized in order to elute uranium and thorium in a solution of a mineral acid, e.g. nitric acid, by the treatment with the mineral acid solution. After the treatment, the alumina is separated from the mineral acid solution by the solid-liquid separation. The nitric acid is most effective as the mineral acid, and followed by sulfuric acid. Hydrochloric acid has a little effect. The concentration of the mineral acid is preferably about 0.5-0.1N. The resultant separated alumina is then washed fully with water and dried.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

特開昭56-164013(2)

水準に低下させる技術は現在のところ知られていない。本発明者はパッケージの主成分であるアルミナ中のウラン及びトリウムの含有量をアルミナ 製造の過程でその原料中の含有骨よりも格とに 近下させ、半導体メモリ 装置のパッケージ 材に 適 で た アルミナ を製造することを目的として 研究 を 液 か ない場合、 これを 正確に行 た うこと は なか な が 外 ない場合、 これを 正確に行 た うこと 「下の低 報 で 等に 0.1 カウント / ト・・・ は 似に なる と 非常に 困難 で あり、 信頼できる 測定 装 置 は 未 だ 開発 されていない。

したがつて、半導体メモリ装置のペッケーシ用アルミナの製法を開発するに当つて、先ずアルファ線を定量的に把握する方法を定める必要があつた。この点に関し、アルミナ中に含まれる放射性元素はウラン(U)及びトリウム(Th)である。ウラン(U)はウラン又はアクチニウム崩壊系列に従つて、またトリウム(Th)はトリウム崩壊系列に従つて崩壊し、最終的には安定な鉛になる。その崩壊過程において、1原子のU²³⁸は8個のアルフ

(3)

ppm以下好ましくは約0.1 ppm以下まで低下させるとソフトエラーを防止できるとの発視のもとに極低ウラン・トリウム含有アルミナ製法の研究を行なつたものである。

本発明の目的は半導体メモリ装置内で用いるの に適した、極低放射性元素含有量のアルミナを製 造する方法を提供することにある。

本発明に係る方法は、実質的にアルファ晶より なる競成アルミナを粉砕し、希薄な鉱酸液中で洗 浄することを特徴とする。

以下、本発明を工程順に説明する。

工業的にアルミナを製造するにはポーキサイトを原料としてパイヤー法により後述する処理を施している。パイヤー法の原料のポーキサイトは産地、鉱区によつて多少異なるが、わが国で用いられているものは3ないし5ppmのウラン及び5~10ppmのトリウムを含有している。このようなポーキサイトを苛性ソーダ液に溶解し、不溶解分(赤死)を沈殿させた時大半のウラン及びトリウムは不溶性赤死とともに沈殿するが、一部はアル

ア線粒子を、また1 原子のU²³⁶は7個のアルファ 線粒子を、トリウム(Th²³²)は6個のアルフェ線 粒子を放射することは、それぞれの崩壊系列によ り定まつている。この他、ウラン、トリウムの核 分裂から生ずる放射性 元素のラジウム (Ra) 、プ ロトアクチニウム(Pa)、アクチニウム(Ac)等 があるが、これらはその成因からみて本発明によ る含有侃低減の対象外である。従つて、アルミナ のアルファ線を測定したくとも、ウラン又はトリ ウムを化学的に分析すれば、ウラン又はトリウム のアルミナ中の含有原子数からアルフェ線粒子の 放射個数を計算することができる。なお、ウラン 又はトリウムの化学的分析精度は、中性子放射化 分析によると、10⁻⁸~10⁻¹⁰9rまで、またウラ ンは螢光分光分析によると10⁻⁵~10⁻¹⁰gr程度 までの十分に高い精度を有するものである。以上 のような分析事情に基づいて、本殊明者は現状の アルミナ中の 0.5 ~ 1.0 ppm 程度のウラン及び 0.0 25~0.05 ppm程度のトリウム含有量に対 し、ウランおよびトリウムの合計含有量で約0.2

(4

ミン酸ソーダ溶液中に移行する。 このようた Tルミン酸ソーダ溶液から加水分解により析出させた水酸化 Tルミニウムは約0.4 ppmのウラン及び約0.0 2 ppmのトリウムを含有している。 かかる水酸化 Tルミニウムを1200℃以上、好ましくは1250~1500℃に焼成すると Tルファ(a)晶の割合が99 を以上の実質的に Tルファ Laからたる焼成 Tルミナが得られる。 この Tルミナ中にはウラン約0.6 ppm、トリウム約0.0 3 ppmが含有されている。

本発明によると上記実質的にアルファ晶からなる焼成アルミナ(以下これをα焼成アルミナと称する)に粉砕及び鉱酸洗浄の処理を施すが、先ず粉砕の意義及び方法について説明する。

α焼成アルミナは1200℃以上、好ましくは
1250~150℃の高温で焼成されているために、アルミナ単結晶粒子が凝集しており、約30~80ミクロンの寸法の塊状になつている。この状態で鉱酸洗浄処理を行なつてもウラン等の放射性元素は鉱酸液中に十分に溶出しない。そこで粉

特開昭56-164013(4)

リゥムの含有量はそれぞれ 0.1 3 及び 0.0 2 5 ppm であつた。

実施例6

実施例1 の場合と同様に電気炉で焼成して得たα焼成アルミナ200grを、24のアルミナポットに直径20 mmのアルミナポール1.6 kgと共に入れ、90 rpm の回転数でアルミナポットを回転しながら8時間乾式粉砕した。

得られた粉砕アルミナ粒子 5 0 str を実施例 1 と同じ硝酸液 5 0 ml に 1 時間浸せき後ろ過し、さらに 2 0 0 ml の水で水洗・乾燥したととろ、得られたアルミナ中のウラン及びトリウムの含有量はそれぞれ 0.0 5 及び 0.0 2 4 ppm であつた

実施例 7

市販の焼結電子材料用低ソーダアルミナ (Na₂O 0.0 6 重量 5)を原料として、鉱酸洗浄処理を行つた。原料アルミナは平均粒子径 2.2 μの事実上αアルミナであり、ウラン含有最 0.4 0 ppm、トリウム含有量 0.0 2 4 ppm である。

鉱酸洗浄処理条件は実施例1と同様の0.5 N 硝

02

は実施例1と同じ条件で、焼成アルミナを処理したところ得られた鉱酸洗浄アルミナ中のウラン及びトリウムの含有景はそれぞれ0.0 4 及び0.0 1 9 ppm であつた。

奥施例3

0.5 N 硝酸 に代えて 0.5 N の塩酸 を使用した他は実施例1 と同じ条件でα 焼成 アルミナを処理したところ、 得られた 鉱酸洗浄 アルミナ 中の ウラン及びトリウム の含有量はそれぞれ 0.0 5 及び 0.0 2 1 ppm であつた。

突施例4

0.5 N 硝酸と 0.5 N 硫酸の等量混酸液を使用した他は実施例 1 と同じ条件 でα 焼成 アルミナを処理したところ、 得られた鉱酸 洗浄 アルミナ中のウラン及びトリウムの含有質 はそれぞれ 0.0 3 ppm 及び 0.0 1 8 ppm であつた。

奥旅例5

硝酸の濃度を0.5 Nから2Nに変えた他は実施例1と同じ条件でα焼成アルミナを処理したところ、得られた鉱酸洗浄アルミナ中のウラン及びト

(11)

酸液中における湿式粉砕である。得られた鉱酸洗 停アルミナ粒子は平均粒子径1.4 αでウラン及び トリウムの含有量はそれぞれ0.0 4 ppm 及び0.0 2 ppm であつた。

比較例1

実施例1の方法で得られたα焼成アルミナ200 grを粉砕せずに、0.5 N 硝酸液 200 皿に1時間 浸せき後ろ過洗浄乾燥したところ、得られたアル ミナ中のウラン及びトリウムの含有量はそれぞれ 0.39及び0.030 ppm であつた。

比較例2

実施例7の原科アルミナを実施例6と同一の条件で粉砕せずに鉱酸洗浄処理したところ得られた アルミナ中のウラン及びトリウムの含有量はそれ ぞれ0.3 5 ppm 及び0.0 2 0 ppm であつた。

特許出顧人

昭和経金属株式会社特許出願代理人

弁理士 * 木 朗 弁理士 西 縚 Ħ 之 弁理士 村 # 卢 14 弁理士 111 \mathbf{G} H74 之

This Page Blank (uspto)